# Be 掺杂纤锌矿 ZnO 电子结构的第一性原理研究\*

唐 鑫<sup>1</sup>) 吕海峰<sup>2</sup>) 马春雨<sup>1</sup>) 赵纪军<sup>3</sup>) 张庆瑜<sup>1</sup><sup>†</sup>

1) 大连理工大学三束材料改性国家重点实验室,大连 116024)
2) 中国科学院计算机网络信息中心,北京 100080)
3) 大连理工大学高科技研究院,大连 116024)
(2008年4月9日收到,2008年7月22日收到修改稿)

采用密度泛函理论结合投影缀加波方法,对 Be 掺杂导致 ZnO 禁带宽度增加的机理进行了研究.通过对掺杂前 后电子能带结构、总态密度以及分态密度的计算和比较,发现导带底(CBM)是由 Be 2s 电子与 Zn 4s 电子共同控制; 而 Be<sub>x</sub>Zn<sub>1-x</sub>O 价带顶(VBM)始终由 O 2p 电子占据.随着掺杂量的增加,决定带隙宽度的 CBM 的位置上升,同时 VBM 的位置下降,从而导致了带隙的变宽,出现了蓝移现象.此外,Be 掺杂会使晶胞发生压缩,这种压应变也是导 致 Be<sub>x</sub>Zn<sub>1-x</sub>O 禁带宽度变宽的原因之一.

关键词:密度泛函理论,电子结构,Be掺杂ZnO PACC:7115M,7115H

### 1.引 言

ZnO 作为新一代的宽带半导体材料,具有优异 的光学、电学以及压电性能,在发光二极管、光探测 器、电致荧光器件、透明导电薄膜、气敏传感器等诸 多领域有着广泛的应用<sup>[1-3]</sup>.自从 1997 年 Tang 等<sup>[4]</sup> 报道了 ZnO 薄膜的近紫外受激发射现象以后,ZnO 再次成为当今半导体材料研究领域的热点.目前,人 们主要致力于以 ZnO 薄膜为基础的光电器件的制 备,而制备的前提就是实现 ZnO 能带的调制.实验研 究<sup>[5-7]</sup>发现,在 ZnO 中掺入 Mg 可以形成Mg,Zn<sub>1-y</sub>O 三元合金 随着 Mg 含量的增加,Mg,Zn<sub>1-y</sub>O 禁带宽 度变大,引起蓝移效应,因此通过控制合金中 Mg 的 含量,可以在蓝光-紫外光波段内有效地调节 ZnO 的 禁带宽度.然而,ZnQ B4,和 MgQ B1)有着不同的晶 格结构,当 Mg 含量 y 达到一定程度( $y \ge 0.36$ ), Mg,Zn<sub>1-y</sub>O 三元合金会出现偏析.

为了避免 ZnO 掺杂过程中偏析的出现,最近开始使用 Be 代替 Mg,以获得增大禁带的效果.这主要 是因为 BeO 的禁带宽度为 10.6 eV,且有着与 ZnO 一 样的晶格结构.在实验方面 ,Ryu 等<sup>18]</sup>采用混合束沉 积(hybrid beam deposition)的方法,已经成功地在 c轴取向 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 基底上生长出了 BeZnO 合金.此后,他 们还制备了 ZnO/BeZnO 量子阱的发光二极管<sup>[9]</sup>.在 理论方面,人们通过计算对 Be, Zn1-, O 合金结构以 及电子属性<sup>[10,11]</sup>进行了深入的探讨,尽管对于 Be 掺 杂 ZnO 的研究已经开展了数年,取得了许多成果, 但仍有许多问题亟待解决 例如 Be 掺杂导致的蓝移 效应的起因.目前针对这个问题的研究相对较少,而 且也没有从  $Be_x Zn_{1-x}$  0 电子结构角度上对这个效应 进行详细的讨论,而对于掺杂 ZnO 的电子结构,通 常采用第一性原理计算进行讨论,大量的报道已经 证明其能成功描述掺杂后的电子结构<sup>[12,13]</sup>.因此,本 文从第一性原理出发,采用超原胞模型计算了  $Be_x Zn_{1-x} O$  的电子结构随 Be 掺杂量 x 的变化 ,并分 析了应变对 ZnO 能带的影响,从理论上对蓝移效应 进行了分析.

### 2. 模型构建与计算方法

本文计算中采用纤锌矿结构 ZnQ(2×2×2)的超原

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金(批准号:10605009,10774018)国家重点基础研究发展规划(批准号:2007CB616902)和中国科学院知识创新工程青年 人才项目(批准号:0714061A01)资助的课题。

<sup>†</sup> 通讯联系人.E-mail qyzhang@dlut.edu.cn

胞模型,如图1所示.超原胞模型由8个ZnO单胞组 成,每个单胞包含2个Zn原子和2个O原子,一共32 个原子.当其中一个Zn原子被Be原子取代时,形成 Be<sub>0.005</sub>Zn<sub>0.935</sub>O三元合金.改变超元胞中取代Zn原子的 Be原子数就可以得到不同Be掺杂量的Be<sub>x</sub>Zn<sub>1-x</sub>O三 元合金(x = 0.0625,0.125,0.1875,0.25).



图 1 包含 1 个 Be 掺杂原子的 ZnC(2×2×2)超原胞模型 (a) 俯视图 (b) 侧视图

本文的第一性原理计算采用的是密度泛函理论 (DFT)<sup>14]</sup>结合投影缀加波(projector augmented wave, 简记为 PAW)<sup>15–17]</sup>方法的 VASP 软件包<sup>[18]</sup>.电子和 电子之间的交换关联势采用广义梯度近似 (GGA)<sup>19]</sup>的 PW91 泛函<sup>[20]</sup>进行处理.平面波的截断 能量为 650 eV,全布里渊区的求和使用 7 × 7 × 4 的 Monkhorst-Pack型 k 点网格<sup>[21,22]</sup>.测试计算表明,进 "增加平面波截断能量和 k 点数目对计算结果 响可以忽略.当系统总能量变化稳定在 1.0 × 10<sup>-5</sup> eV 内时,电子结构的自洽场计算停止并认为达 到收敛.进行原子结构弛豫时,当每个原子上的作用 力小于 0.01 eV 时,弛豫过程结束.此外,在计算的 过程中,0 2s 2p Zn 3d As 和 Be 2s 电子被当做价电 子处理,价电子与原子芯之间的相互作用以 PAW 势 描述.

### 3. 结果及讨论

#### 3.1. ZnO BeO 结构优化和电子结构

首先,对纤锌矿结构的 ZnO,BeO 单胞进行了结构优化,结果如表 1 所列.表 1 同时还给出了文献 [23—27 的实验值和理论计算值.计算所得的 ZnO 晶格常数为 a = 0.328 nm, c = 0.5297 nm,与实验 值<sup>[23]</sup>的偏差仅为 1%左右.分子结合能为 7.527 eV, 也与实验值<sup>[23]</sup>符合很好.此外,本文对 BeO 的计算 结果也与前人的理论计算值<sup>[27]</sup>是一致的.这说明本 文所采用的计算方法和计算中所选取的参数设置是 可靠的.

根据优化后的晶体结构,我们计算了纤锌矿结 构的 ZnO,BeO 的态密度(DOS)以及能带结构.图 2 为 ZnO 的电子总态密度(TDOS),分态密度(PDOS) 分布和能带结构.由图 χ a)可知 ZnO 的禁带宽度最 窄处出现在 Γ 点,为直接带隙.在 Γ 点,价带顶 (VBM)与导带底(CBM)之间带隙宽度为 0.752 eV, 与其他 DFT 的计算值(文献[24]为 0.73 eV,文献 [28]为 0.80 eV)是一致的,但这些理论值与实验值 (3.37 eV)相比明显偏小.一般认为,导致计算结果 偏差的原因主要是采用基于 GGA 的 DFT 对电子与 电子之间的交换关联作用处理不足引起的<sup>[29]</sup>.由于 本文更多关注的是在不同掺杂量下带隙的相对变化 规律,而且计算体系和计算的参数都相同,不同的只

表 1 结构优化后 ZnO 和 BeO 单胞的晶格常数以及 ZnO 或 BeO 分子结合能与实验值和其他理论计算值的比较

	a/nm	c/nm	c/a	分子结合能/eV	资料来源
	0.3280	0.5297	1.615	7.53	本 文
7-0	0.3258	0.5220 1.602 7.52	7.52	文献 23 实验值	
ZnO	0.3283	0.5309	1.617	7.20	文献 24 理论值
	0.3292	0.5292	1.608	7.69	文献 25 理论值
BeO	0.2708	0.4396	1.629	6.20	本 文
	0.2698	0.4376	1.622	—	文献 26 实验值
	0.2714	0.4413	1.626	6.36	文献 27 理论值

是掺杂量,因此尽管计算的绝对值与实际有偏差,但 是使用 GGA 得到的禁带宽度变化规律还是可信的. 目前,对于带隙变化问题,GGA 已经成为最常用的 方法之一<sup>[30]</sup>.



图 2 纤锌矿 ZnO 的能带结构以及 DOS 设置 ZnO 的 VBM 为能 量零点 (a)ZnO 的能带结构,阴影部分为禁带 (b)ZnO 的 PDOS 以及 TDOS

结合图 2 中的 TDOS 以及 Zn 和 O 的 PDOS 可以 发现 ZnO 的价带最底部由 O 2s 电子占据,在高能 区则主要由 Zn 3d 电子和 O 2p 电子杂化而成. Zn 3d 电子主要分布在 – 5.82— – 4.02 eV 的能量区间; O 2p 电子主要分布在 – 3.02—0 eV 的区间,即 VBM 主要由 O 2p 电子主导.导带主要是由 Zn 4s 电子占 据,CBM 的位置自然取决于 4s 电子的最低能量.所 以 ZnO 的带隙宽度主要由 O 2p 电子和 Zn 4s 电子所 决定.

计算得到的 BeO 的能带结构、TDOS 以及 PDOS

如图 3 所示. 与 ZnO 相比, BeO 同样为直接带隙, VBM 和 CBM 都出现在 Γ 点,带隙宽度为 7.638 eV, 小于实验值(10.6 eV).这同样是由于 GGA 的 DFT 计算过低地估计了能带宽度.与其他的 DFT 理论计 算结果(文献 27]为 7.44 eV, 文献 31]为 7.54 eV) 相比,本文的计算值还是大致合理的.

对计算得到的 ZnO 与 BeO 的能带结构进行比 较后可以发现,在 BeO 中各个特征 k 点的 CBM 的能 量值相差不大,分布比较平滑,特别是在 $\Gamma$  点的 CBM 附近,其曲率较 ZnO 的 CBM 小很多,这意味着 BeO 有更大的有效电子质量.而在价带,BeO 的分布 和 ZnO 的分布是相似的,只是 BeO 中没有 d 电子的 分布.而从 DOS 上看,VBM 和 CBM 分别由 O 2p 电子 和 Be 2s 电子占据.此外,在价带中还有部分 Be 2p 电子,这主要是由于 BeO 中存在的 p-p(Be 2p 电子 与 O 2p 电子)相互作用<sup>[32]</sup>导致的.



图 3 纤锌矿 BeO 的能带结构以及 DOS 设置 BeO 的 VBM 为能 量零点.(a) BeO 的能带结构,阴影部分为禁带(b)BeO 的 PDOS 以及 TDOS

#### 3.2.Be 掺杂 ZnO 的电子结构

实验上观察到 Be 掺入 ZnO 后,禁带带隙变宽. 要理解这种能带变化的根本原因,需要对掺杂后的 Be<sub>x</sub>Zn<sub>1-x</sub>O 三元合金的电子结构进行细致分析.首 先分别对不同掺杂量的 Be<sub>x</sub>Zn<sub>1-x</sub>O (*x* = 0.0625, 0.125,0.1875,0.25)的晶体结构和原子位置进行 了结构弛豫,然后考察它们的禁带宽度和电子结构 的变化.图4是本文计算的禁带宽度值与文献 8 实 验值的比较.由图4可以看出,尽管 DFT 会产生计 算误差,不过在变化趋势和曲线斜率上,本文的结果 和实验结果还是一致的.



图 4  $Be_x Zn_{1-x} O$  禁带宽度的计算值和实验值

带隙的变化归根结底是掺杂后 CBM 和 VBM 的 变化 因此 要探讨禁带宽度变小的原因 需要具体 地分析 CBM 和 VBM 的能量位置随着掺杂量 x 的变 化.但是由于本文计算中使用的赝势方法,在不同掺 杂量下计算出来的 VBM 绝对能量值没有直接的可 比性,因此 要建立不同掺杂量下 VBM 之间的联系, 需要借助全电子计算.这里,我们使用 DMol<sup>3</sup> 软件 包<sup>[33]</sup>对上述 VASP 计算弛豫得到的结构,使用相同 的 k 点数和 DNP 基组进行全电子计算. 通过全电子 计算,可以得到不同掺杂量下 VBM 相对于真空能级 的能量.图 f(a)是 Be<sub>x</sub>Zn<sub>1-x</sub>O ZnO 和 BeO 的 VBM 相 对真空能级的位置示意图,从图 5(a)可以发现,尽 管 ZnO 和 BeO 的 VBM 都同样是由 O 2p 电子控制, 但是 BeO 的 VBM 却低于 ZnO 的 VBM. 若以纯 ZnO 的 VBM 为参照零点 结合上述赝势计算中得到的带 隙宽度,可以描绘 CBM 和 VBM 随 Be 掺杂量的变 化如图5(b)所示.

由图 5 可知 ,CBM 的升高和 VBM 的下降导致了



图 5 不同 Be 掺杂量下 , $Be_x Zn_{1-x}$ O 合金的 VBM 及 CBM 的相对 能级位置 (a) $Be_x Zn_{1-x}$ O ZnO 和 BeO 的 VBM 相对真空能级的 位置示意图 ,设置真空能级为能量零点 (b)CBM 和 VBM 随掺杂 量的变化 ,设置 ZnO 的 VBM 为能量零点

Be 掺杂 ZnO 带隙变宽.对于 CBM 的上升,可以认为 是由于 Zn 4s 电子与 Be 2s 电子的杂化效应引起的. 当 Zn 原子和 O 原子结合形成 ZnO 晶体时,Zn 4s 电 子与 O 2p 电子相互作用,形成类 p 的成键和类 s 的 反键.成键向低能方向移动,反键向高能方向移动, 从而形成带隙.当掺杂 Be 后,由于 Be 2s 电子有着 更高的能量,这样会使得由 Zn 4s 电子和 Be 2s 电子 一起组成的导带向高能移动.因此 Be 的掺入势必导 致 CBM 能量的显著上升.

而对于 VBM 的下降 本文运用分子轨道理论进 行讨论.图 6 为 ZnO ,BeZnO 合金以及 BeO 的轨道能 级相互作用图.由于阴离子的 p 电子和阳离子的 s 电子之间的杂化能级出现在价带的低能态,对 VBM 的影响不大,所以这里没有给出阳离子的 s 电子情 况.在 BeO 中,其结构为纤锌矿结构,每个 Be( O )原 子周围都存在呈四面体分布的四个 O( Be )原子.在 四面体结构中,O 2p 电子会和 Be 2p 电子成键,形成 成键( $\Gamma_{15v}$ 即为 VBM)和反键(导带中的 $\Gamma_{15c}$ ),这也 是为什么在价带中存在 Be 2p 电子的原因,如图 3 (b)所示.而对于 ZnO,除了有 p-p 相互作用外,由于 Zn 有 3d 电子的存在,还存在 p-d 相互作用.这种 p-d 相互作用也被称为 p-d 排斥效应<sup>[32]</sup>,是专门用于描 述纤锌矿和闪锌矿结构中阳离子的 d 电子和阴离子 的 p 电子之间相互作用对 VBM 以及带隙等影响的 理论.在 ZnO 晶体中,Zn 原子周围的 4 个 0 原子呈 四面体结构分布,因此 Zn 的 3d 轨道会分裂成对称 性分别为 e 和  $t_2$  的轨道.e 轨道分布在 – 4.3 eV 左 右,不参与成键,如图 2(b)所示,e 轨道的分布比较 局域化. $t_2$ 轨道电子会和 0 2p 电子杂化,分裂成两 个能级,一个是价带底部的,另一个与 p-p 成键一起 组成  $\Gamma_{15v}$ ,从而决定 VBM 的能量高低.p-p 相互作用 使  $\Gamma_{15v}$ 向低能方向移动,而 p-d 相互作用使  $\Gamma_{15v}$ 向高 能方向移动.当 Be 掺杂后,由于 Be 没有 d 电子, 会减弱p-d 相互作用,因此 VBM 会降低.图 7 为 Be<sub>0.25</sub>Zn<sub>0.75</sub>O的 TDOS 分布,由于 O 2s 电子并不参与 杂化,所以没有在图中显示.由图 7 可知,Be<sub>0.25</sub>Zn<sub>0.75</sub>O 的 VBM如图 6 所描述的那样,降低到 – 0.35 eV (以 ZnO 的VBM 为能量零点),同时禁带宽度增 大为 1.53 eV. e 轨道和 VBM 位置(图 7 中箭头处) 也都向低能方向移动,分别由未掺杂时的 – 4.3 和 – 6.0 eV 降低到 25% Be 掺杂时的 – 4.6 和 – 6.4 eV,这应该也是由于 p-p 相互作用增加导致 的结果.



图 6 ZnO BeZnO 合金和 BeO 的能级相互作用



图 7 Be0.25 Zn0.75 O 的 TDOS 分布 设置 ZnO 的 VBM 为能量零点

我们还具体分析了价带中 Zn 3d 电子和 O 2p 电子随 Be 含量 x 的变化.图 8 是平均每个 Zn 原子 和 O 原子的 PDOS.从图 8 可以发现  $_{e}$  轨道的 Zn 3d 电子正如图 6 所描述的一样 随 Be 的含量增加会向 低能态移动.同时还可发现  $_{e}$  轨道的局域化程度也 在降低 这主要是由于 Be 的离子半径较小 ,掺入后 会导致大的晶格畸变 ,改变了原来的正四面体结构 , 从而使原来非成键的  $_{e}$  轨道也参与成键.在价带高 能部分的 O 2p 电子 ,同样由于与 Be 2p 电子的杂 化 ,也变得非局域化.因此通过价带的 PDOS 分析可 知 ,Be<sub>x</sub>Zn<sub>1-x</sub>O 合金的各电子 DOS 分布都会随着 Be 含量 x 的增加而变得非局域化 ,这必将会引起光学 属性( 如介电常数等 )的变化.



图 8 随着 Be 含量增加 ,Be<sub>x</sub>Zn<sub>1-x</sub>O 合金中各个轨道电子分布 的变化 设置 ZnO 的 VBM 为能量零点.(a)平均每个 Zn 原子的 3d 电子的 PDOS (b)平均每个 O 原子的 2p 电子的 PDOS

#### 3.3. 应变对 ZnO 能带的影响

由于 Be 离子的半径比 Zn 离子半径小,因此当 Be 掺杂后必然会引起晶格常数的减小,实验结果<sup>[8]</sup>

已经证明了这一点.图 (a)所示是本文计算的晶格 常数随 Be 掺杂量 x 的变化.



图 9  $Be_x Zn_{1-x} O$  合金中晶格常数随 Be 掺杂量 x 的变化以及晶 格应变对纯 ZnO 带隙宽度的影响 (a) 晶格常数随 Be 掺杂量的 变化 (b) 在压应变条件下(与  $Be_x Zn_{1-x} O$  晶格常数相同 )纯 ZnO 晶体的禁带宽度

从图  $(x_a)$ 可以看出 随 Be 掺杂量 x 的增加 ,晶 格常数 a 和 c 都有不同程度的减小 . 而理论计算曾 经证明<sup>251</sup> ,外应力对 ZnO 的禁带宽度是有一定影响 的 . 如上所述 ,ZnO 是 WZ 结构 ,若不考虑极化作用 , WZ 结构中激子 A( $\Gamma_{9v} \rightarrow \Gamma_{7c}$ )<sup>341</sup>的跃迁决定了禁带 宽度 .  $\Gamma_{9v}$  , $\Gamma_{7c}$ 态的能量位置在不同的应变方向下变 化是各向异性的 ,其具体的变化与各个方向的弹性 常数、能带的晶格场分裂以及自旋分裂有关<sup>[35]</sup>. 但 目前的实验和理论都证明<sup>[35]</sup> ,ZnO 中激子 A 的能量 (与禁带宽度相关 )在处于压应变时变大 ,而处于张 应变时变小 . Be 掺杂导致 ZnO 处于压应变状态 ,从 而对带隙的增加有一定的贡献 . 图  $(x_b)$ 是压应变条 件下(与 Be<sub>x</sub>Zn<sub>1-x</sub>O 晶格常数相同 )纯 ZnO 晶体的禁 带宽度 . 可以看到 ,随着晶格常数的变小 ,ZnO 的禁 带宽度呈现增加的趋势.以  $Be_{0.25}Zn_{0.75}O$ 为例,结合 图 9(b)和表 2 可以发现,掺杂引起的应变量为 4.1%.相同应变条件下,纯 ZnO 的禁带宽度只有 0.950 eV,禁带宽度增加了 0.198 eV,此时  $Be_{0.25}Zn_{0.75}O$ 的禁带宽度为1.535 eV,禁带宽度增加了 0.783 eV. 因此,可以认为  $Be_{0.25}Zn_{0.75}O$ 的禁带宽度的下降约有 25.3%来源于晶格常数的变化.从表 2 还可以看出, Be 掺杂引起应变对  $Be_{x}Zn_{1-x}O$ 禁带宽度的贡献平 均保持在 28%左右.

表 2 Be<sub>x</sub>Zn<sub>1-x</sub>O 合金中不同掺杂量产生的 应变对带隙宽度的影响

<i>x</i>	应变导致 带隙增加 量/eV	掺杂后带隙 总增加量/eV	带隙增加中 应变因素所占 比例/%				
0.0625	0.049	0.157	31.2				
0.1250	0.098	0.364	26.9				
0.1875	0.148	0.527	28.1				
0.2500	0.198	0.783	25.3				

- [1] Bagnall D M, Chen Y F, Zhu Z, Yao T, Koyama S, Shen M Y, Goto T 1997 Appl. Phys. Lett. 70 2230
- [2] Ryu Y R , Kim W J , White H W 2000 J. Cryst. Growth 19 419
- [3] Aoki T, Hatanaka Y, Look D C 2000 Appl. Phys. Lett. 76 3257
- [4] Tang Z K , Wong G K L , Yu P 1998 Appl. Phys. Lett. 72 3270
- [5] Makino T , Chia C H , Tuan N T , Segawa Y , Kawasaki M , Ohtomo A , Tamura K 2000 Appl. Phys. Lett. 77 1632
- [6] Ohtomo A, Kawasaki M, Koida T, Masubuchi K, Koinuma H 1998 Appl. Phys. Lett. 72 2466
- [7] Ohtomo A , Shiroki R , Ohkubo I , Koinuma H , Kawasaki M 1999 Appl. Phys. Lett. 75 4088
- [8] Ryu Y R , Lee T S , Lubguban J A , Corman A B , White H W , Leem J H , Han M S , Park Y S , Youn C J , Kim W J 2006 Appl . Phys. Lett. 88 052103
- [9] Ryu Y R , Lee T S , Lubguban J A , White H W , Kim B J , Park Y S , Youn C J 2006 Appl . Phys. Lett. 88 241108
- [10] Fan X F, Zhu Z X, Ong Y S, Lu Y M, Shen Z X, Kuo J L 2007 Appl. Phys. Lett. 91 121121
- [11] Ding S F , Fan G H , Li S T , Chen K , Xiao B 2007 Physica B 394 127
- [12] Jin X L, Lou S Y, Kong D G, Li Y C, Du Z L 2006 Acta Phys. Sin. 55 4809 (in Chinese)[靳锡联、娄世云、孔德国、李蕴才、 杜祖亮 2006 物理学报 55 4809]
- [13] Xu L, Tang C Q, Dai L, Tang D H, Ma X G 2007 Acta Phys. Sin. 56 1048 (in Chinese)[徐 凌、唐超群、戴 磊、唐代海、 马新国 2007 物理学报 56 1048]
- [14] Hohenberg P, Kohn W 1964 Phys. Rev. 136 B864

### 4.结 论

本文采用 DFT 结合 PAW 方法,对掺杂 Be 导致 ZnO 禁带宽度增加的机理进行了研究.通过比较掺 杂前后的能带结构和 DOS 的变化发现,Be 2s 轨道 电子能量高于 Zn 4s 轨道电子,杂化后的轨道能量 较原来的 Zn 4s 轨道电子有较大的上升,因此由 s 电 子控制的 CBM 相应地出现较大的上升,而 Be 的掺 杂减弱了 ZnO 中存在的 p-d 排斥效应,致使 O 2p 轨 道电子能量降低,进而导致由其控制的 VBM 能量也 下降.对 DOS 的分析表明,BeZnO 合金的各个电子 PDOS 分布都会变得更加非局域化,这也会引起相关 光学属性发生一定的变化.随着掺杂量的增加,决定 带隙宽度的 CBM 和 VBM 位置分别出现了上升和下 降,因此导致了带隙的变宽,出现了蓝移现象.此外, Be 掺杂 导致 晶胞 发生 压缩,这种 压应变 也是 Be,Zn<sub>L-x</sub>O 禁带宽度变大的一个不可忽略的原因.

- [15] Kresse G , Joubert D 1999 Phys. Rev. B 59 1758
- [16] Adolph B , Furthmuller J , Bechstedt F 2001 Phys. Rev. B 63 125108
- [17] Blochl P E 1994 Phys. Rev. B 50 17953
- [18] Kresse G , Furthmuller J 1996 Comput. Mater. Sci. 6 15
- [19] Kohn W , Sham L J 1965 Phys. Rev. 140 A1133
- [20] Perdew J P , Chevary J A , Vosko S H , Jackson K A , Pederson M R , Singh D J 1992 Phys. Rev. B 46 6671
- [21] Monkhorst H J , Park J D 1976 Phys. Rev. B 13 5188
- [22] Pack J D , Monkhorst H J 1977 Phys. Rev. B 16 1748
- [23] Decremps F , Datchi F , Saitta A M , Polian A 2003 Phys. Rev. B 68 104101
- [24] Schleife A, Fuchs F, Furthmuller J, Bechstedt F 2006 Phys. Rev. B 73 245212
- [25] Jaffe J E , Snyder J A , Lin Z , Hess A C 2000 Phys. Rev. B 62 1660
- [26] Hazen R M , Finger L W 1986 J. Appl. Phys. 59 3728
- [27] Amrani B, Hassan F E H, Akbarzadeh H 2007 J. Phys : Condens. Matter 19 6216
- [28] Janotti A, Segev D, Van de Walle C G 2006 Phys. Rev. B 74 045202
- [29] Anisimov V I, Aryasetiawan F, Lichtenstein A I 1997 J. Phys: Condens. Matter 9 767
- [ 30 ] Osuch K , Lombardi E B , Gebicki W 2006 Phys. Rev. B 73 075202
- [31] Xu Y N, Ching W Y 1993 Phys. Rev. B 48 4335
- [32] Wei S H , Zunger A 1988 Phys. Rev. B 37 8958

- [33] Delley B J 2000 J. Chem. Phys. 113 7756
- [34] Özgür Ü, Alivov Y I, Liu C, Teke A, Reshchikov M A, Doğan S, Avrutin V, Cho S J, Morkoç H 2005 J. Appl. Phys. 98 041301
- [ 35 ] Langer D W , Euwema R N , Era K , Koda T 1970 *Phys* . *Rev* . B **2** 4005

## First-principle study of electronic structure of Be-doping wurtzite ZnO\*

Tang Xin<sup>1</sup>) Lü Hai-Feng<sup>2</sup>) Ma Chun-Yu<sup>1</sup>) Zhao Ji-Jun<sup>3</sup>) Zhang Qing-Yu<sup>1</sup>)<sup>†</sup>

1 X State Key Laboratory for Materials Modification by Laser , Ion and Electron Beams , Dalian University of Technology , Dalian 116024 , China )

2 X Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China)

3 X College of Advanced Science and Technology, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China)

(Received 9 April 2008; revised manuscript received 22 July 2008)

#### Abstract

Using the density-functional theory combined with the projector augmented wave method, we have investigated the electronic structure of Be-doping wurtzite ZnO. The band structure, total density of states and partial density of states of  $Be_x Zn_{1-x} O$  are presented and show that the valence band maximum (VBM) is determined by O 2p electrons and the conduction band minimum (CBM) is occupied by the hybrid Be 2s and Zn 4s electrons. The energies of CBM increase and the energies of VBM decrease with increasing Be-doping concentrations. Both effects lead to broadening of the band gap. Furthermore, it was found that Be-doping can cause compressive strain in the crystal structure, which also widens the band gap.

Keywords : density functional theory , electronic structures , Be-doping ZnO PACC : 7115M , 7115H

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 10605009, 10774018), the State Key Development Program for Basic Research of China (Grant No. 2007CB616902) and the Young Researchers Program of the Knowledge Innovation of Chinese Academy of Sciences (Grant No. 0714061A01).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail : qyzhang@dlut.edu.cn